

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成25年6月3日現在

機関番号:12612			
研究種目:若手研究(B)			
研究期間:2012~2013			
課題番号:23740306			
研究課題名(和文) 多価イオン照射による固体表面ナノ構造生成過程の研究			
研究課題名(英文) Study of nano-scale surface modification processes induced by slow			
highly charged ion collisions			
研究代表者			
大橋 隼人 (OHASHI HAYATO)			
電気通信大学・レーザー新世代研究センター・非常勤研究員			
研究者番号:60596659			
「「「「「」」」」」「「「」」」」「「」」」」」「「「「「」」」」」「「「「」」」」			

研究成果の概要(和文):本研究では多価イオン源(EBIT)で生成されたイオンを低速で高配向性 グラファイト(HOPG)に衝突させた際に形成されるナノサイズの微細構造生成過程の研究を行っ た。衝突イオン価数を大きくすると生成される突起状構造の直径が大きくなり、その形状はビ スマス 70 価と 75 価の間でカルデラ状に変化することが確認された。また、入射角度を変化さ せることで非対称隆起や1個のイオンで複数の表面改質を引き起こしたことを示唆する大変興 味深い結果が得られた。

研究成果の概要 (英文): We have studied about nano-scale surface modification processes induced by slow highly charged ion collisions on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG). The diameter of hillock induced by an ion increases with increasing potential energy of incident ions. The shape of induced modifications has changed from a hillock-like to a caldera-like between Bi⁷⁰⁺ and Bi⁷⁵⁺. In gradient incidence experiments, we observed interesting surface modifications that are asymmetric hillocks and several hillocks induced by an incident ion.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	3, 500, 000	1,050,000	4, 550, 000

研究分野:数物系科学 科研費の分科・細目:原子・分子・量子エレクトロニクス キーワード:原子・分子,多価イオン,固体表面

1. 研究開始当初の背景

低速多価イオンが固体に衝突した際,衝突 条件によって様々な固体表面状態変化が起 こることが報告されている。この状態変化は 多価イオンが衝突した場所から数 nm 程度の 範囲内で起こるので,任意の場所に任意の大 きさの表面ナノ微細構造が生成することが 可能になれば,表面微細加工技術としての応 用が期待される。しかし,その生成メカニズ ムは一部が解明されてきたものの,未だ謎に 包まれている部分の多い多価イオン衝突反 応過程であり,魅力的な原子物理学の研究対 象である。 研究開始当初までに報告されている代表的 な事柄

- (1) 低速多価イオンは固体表面に接近した際 に、固体から電子を高励起状態へ捕獲す る。その電子が遷移する際のエネルギー を受け取ったイオン内別電子が、真空中 へ放出される(Auger 過程)。
- (2) 固体表面近傍で電子を多数失ったことで 局所的に帯電した領域が、クーロン爆発 することで表面構造が変化する。(1 衝突 で1構造変化)
- (3) 表面ナノ構造変化は、衝突多価イオンの ポテンシャルエネルギー(PE)に強く依存

する。

- (4) ナノ構造変化は、絶縁体、酸化物、半導 体及び導体の固体表面で観測されている。
- (5) ナノ構造変化として、突起状(Hillock)、 クレーター及びカルデラ構造が報告され ている。
- 2. 研究の目的

本研究の目的は、多価イオンが固体表面に 衝突する際の放出電子及びX線のエネルギー を測定することで、多価イオンから固体に付 与されるエネルギーと固体表面に形成され る表面ナノ構造の関係を解明することであ る。表面ナノ構造は多価イオンのポテンシャ ルエネルギーに依存するとされているが、放 出電子及び X 線のエネルギーを同時計測し, 固体への付与エネルギーが見積もられたこ とはない。本研究では磁気ボトルを用いた飛 行時間型電子エネルギー分析器を開発し、効 率的な放出電子エネルギーの測定と同時に X 線エネルギー分析、その後固体表面状態を観 測することで, 衝突過程において多価イオン が固体に与える影響とそのメカニズムを明 らかにする。

(1) <u>表面ナノ構造のポテンシャルエネルギー</u> 依存性

A.S. El-Said *et al.* (Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B <u>258</u> 167 (2007))の CaF₂(111)表面への多価イオン照射実験 によれば, Hillock 直径と照射イオンの ポテンシャルエネルギーの関係性には 2 つの閾値があり,これらは照射イオンか らのエネルギー付与による標的物質の局 所的な融解と昇華の相転移が起因するも のとされている。ここでは付与されたエ ネルギーは孤立多価イオンそのもののPE とされており,Auger 電子や X 線放射に よるエネルギーの散逸は考慮されていな い。

(2) 放出電子数及び電子エネルギー測定

多価イオンの固体表面への衝突では前 節(1)の様に電子が放出されるが,その数 は入射イオンの価数に依存し,50価程度 の多価イオンの場合はイオン1個当たり 100個以上にもなる。しかし,その電子 の運動エネルギーに関しては,放出角度 が制限された測定しか行われていない。

(3) <u>放射 X 線エネルギー測定</u> 照射多価イオンの価数が低い(≈ PE が 低い)時は,固体表面に近付いた際の固体 標的から入射イオンの励起状態への電子 捕獲により,Auger 過程を経て多数の低 エネルギー電子が放出される。一方,K または L 殻に空孔を持つ高価数重イオン 衝突時には、数 keV のエネルギーを持つ 電子が放出され、且つ X 線放射によるエ ネルギーの散逸が無視出来ない競合脱励 起過程となってくる。また、Tona *et al.*(Phys. Rev. A <u>77</u> 052902 (2008))に よれば K 殻に空孔を持つH-like イオン衝 突でも、L 殻への遷移に伴う L-Auger 電 子が固体標的励起過程の重要な役割を担 っているとされている。しかし、これは 直接 Auger 電子のエネルギー測定を行っ たのではなく、放射 X 線エネルギー分布 からの推測である。

- (4) これまでの研究内容の不足点
 - ①多価イオンが固体へ付与するエネルギーの正確な見積もり。
 - ②1回の多価イオン衝突における、全放出 電子の捕集及びエネルギー分析。

③放射 X線と放出電子エネルギーの相関。

(5) 本研究による解決方法

過去の研究から,表面ナノ構造変化が 入射多価イオンの PE に依存しているこ とは明らかであるが,実際に固体へ付与 するエネルギーは単なる PE ではない。多 価重イオンになると Auger 電子と X 線放 射によるエネルギーの散逸が無視出来な くなるので,本研究ではこれらを同時測 定することにより,より正確な付与エネ ルギーの見積もりを行い,表面構造変化 との関係を明らかにする。

3. 研究の方法

本研究では電子ビームイオントラップ (EBIT)で生成した多価イオンを単一価数イ オンビームとして選別した後に固体表面へ 照射し, 衝突時の放出電子数及びエネルギー の測定を磁気ボトルを用いた飛行時間型分 析法により行う。また,放射X線エネルギー も半導体検出器を用いて同時測定し、ビーム 照射後には走査型トンネル顕微鏡(STM)によ って固体表面状態を観測する。入射多価イオ ンのポテンシャルエネルギー, 放出電子エネ ルギーと放出 X 線エネルギーから固体への付 与エネルギーを見積もり,多価イオン衝突に よる表面ナノ構造生成過程を明らかにする。 先ず放出電子捕集兼エネルギー分析装置を 開発した後,慎重にその性能評価を行い, 様々な固体標的を対象に測定を行う。また, 本研究では衝突領域に磁場が印加されてい る為,磁場の有無による表面構造変化の違い も検証する。

(1) 磁気ボトルを用いた飛行時間型エネルギ 一分析器の開発

放出電子数及び電子エネルギーを測定 する為に,磁気ボトルを用いたエネルギ 一分析器を開発する。これは光と気体分 子標的の衝突実験において確立された技 術を, 固体表面衝突実験に初めて応用す るものである。基本原理としては、磁気 ボトル先端付近のサブ Tesla 程度の磁場 と, *μ*-metal で磁気遮蔽された領域内の ソレノイドコイルにより生成された磁場 を組み合わせて利用し, 効率良く放出電 子を捕集してエネルギー分析を行う装置 である。本研究では、入射多価イオンを 磁場と平行な向きで飛行させ固体表面に 衝突させることで,磁場の影響による入 射イオンの軌道変化を最小限に抑える。 開口率 50 %の穴開き Multi-Channel Plate (MCP, gain 10⁴)を2段組みで電子 検出器に用いる場合,50価の多価イオン 衝突1回当たり100個以上の電子が放出 されるので、捕集率100%を仮定すると 1 衝突当たり 25 個以上の電子のエネルギ 一分析が可能である。

(2) 放出 X 線のエネルギー測定

多価イオン固体表面衝突時に生成され る入射イオンの励起状態の殆どが Auger 過程により脱励起するが、K 殻に空孔の ある多価 Ar イオンの励起状態は, 理論計 算によればその約16%がX線放射によ り脱励起する。50 価の多価イオン1 個が 固体表面に衝突する際には, 励起状態が 約100回以上生成されることが放出電子 数から推測され, 且つ入射イオンのポテ ンシャルエネルギーが増加するにつれて 放射脱励起の割合も増加すると考えられ る。従って、本実験において有感面積250 mm²のX線検出器を30 cm離れた位置に設 置した場合は、毎秒約38個以上のX線の エネルギー分析を行うことが可能と見積 もれる。

 (3) <u>STM による多価イオン照射後の固体表面</u> <u>状態観測</u>

多価イオン照射により生じる固体表面 のナノ構造変化を、大気に曝すことなく 真空中で固体標的を移動させ、STMによ り観測する。多価イオン1個当たり構造 変化が1つ生じることから、本研究室の 実験における典型的な多価イオンビーム (直径1 mm,イオン毎秒10⁴個)を用いる と、STM でスキャンする範囲内(100 nm x 100 nm)に表面構造変化を複数個観測す る為には、最低約4.5 時間の照射時間を 要することになる。この照射時間が長い ことから、前述の電子及びX線測定は十 分な S/N 比で測定結果を得ることが可能 となる。

- (4) 磁場の表面微細構造変化過程への影響本研究では固体標的近傍にサブ Tesla程度の磁場を配置する為、無磁場時の多価イオン照射による表面ナノ構造変化とは異なる現象が、特に標的固体が常磁性体の時に顕著に現れると考えられる。また、Auはバルクでは反磁性を示すが、数nmの微粒子状態では自発磁気モーメントが出現することが報告されている。本実験の多価イオン衝突時には孤立粒子へ小クラスターサイズのAuが生成されるので、これらが磁場の影響を受け、無磁場状態の時と異なる測定結果が得られる可能性もあり得る。これらに着目しつつ、磁場による影響を評価する。
- (5) <u>系統的測定(付与エネルギーと表面構造</u> 生成過程の関係性解明)

本研究は過去に独立に測定されてきた (i)放出電子数,(ii)放出電子エネルギー および(iii)放出 X線エネルギーの測定と, (iv)固体表面状態の観測を,1回の実験 で行うものである。測定すべき依存性と しては,主に(I)入射イオンのポテンシ ャルエネルギー(ミイオン価数),(II)入 射角度(ミ入射速度),(II)標的固体の種 類である。これらを幅広い条件で系統的 に測定することで,多価イオンが固体に 付与するエネルギーと表面ナノ構造生成 過程の関係性を理解する為のデータを取 得する。

4. 研究成果

本研究では電子ビームイオントラップを 用いた低速多価イオン照射による固体表面 ナノ微細構造の生成過程について,STMによ る表面観察以外に放出X線及び電子エネルギ 一分析,磁場効果等の多角的分析研究を計画 していたが,本研究室で使用していたSTMの 故障により他研究室から別のSTMを移設した ことに伴う実験装置の制約の為,入射イオン 価数及びポテンシャルエネルギー依存性,入 射角度依存性の研究に重点を置いた。

多価イオン照射による固体表面ナノ微細 構造について,HOPG を標的固体として,50 ~75 価の多価 Bi イオンを照射した際に生成 されるナノ微細構造の直径及び形状を調べ る測定を行った。過去の報告では,50 価程度 ではHillock 構造,73 価では周囲が隆起した カルデラ状の衝突痕観測されており,その中 間を補う目的の実験であったが,価数が大き くなるにつれナノ微細構造の直径は単調増 加していき,70 価ではHillock 状,75 価で はカルデラ状の照射痕が観測され,形状の変 化は70 価と73 価の間で起きていることを示 唆する結果が得られた。

HOPG 固体表面への多価イオン照射時に生成されるナノ微細構造の大きさはイオンの 価数に比例するという報告があり,今回の結果はそれを支持するものであったが,ポテン シャルエネルギーの差による寄与を検証す る為,50 価の多価ヨウ素イオン照射による実 験も行った。ポテンシャルエネルギーが 50 keV,100 keV と倍違うにも関わらず,両 者のナノ構造の直径は誤差範囲内で一致し た。他の同価数異ポテンシャルエネルギー測 定や誤差を小さくすることが今後の課題で ある。

HOPG 固体表面への入射角度依存測定では, 入射角 60°の時に高低差非対称の楕円状の 照射痕,入射角 30°の時には1回のイオン衝 突により2つの衝突痕が観測され,顕著な興 味深い入射角度依存性を示唆する結果が得 られたが,統計が少ない上に低解像度観測し か行えていない為,今後追実による検証を行 う。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

なし

〔学会発表〕(計0件)

なし

〔図書〕(計0件)

なし

〔産業財産権〕

なし

〔その他〕 ホームページ等 http://yebisu.ils.uec.ac.jp/nakamura/

6.研究組織
(1)研究代表者 大橋 隼人 (OHASHI HAYATO)
電気通信大学・レーザー新世代研究センタ
ー・非常勤研究員
研究者番号:60596659